

2006年3月期第1四半期決算説明会

2005年8月5日

株式会社ホロン

JQ7748

Solutions for Mask & Wafer Metrology

INDEX

- 1.第1四半期業績の概要について
- 2.当期の業績見通し修正について
- 3.新製品の販売について

1.第1四半期業績の概要について

第1四半期業績のサマリー

- 第1四半期においては、製品売上が無かったため、売上高 90百万円、営業利益 98百万円、経常利益 97百万円、純利益 62百万円にとどまる。
- 当社が量産ラインにおいて例外的と考えていたレジストマスクの測定を、競合企業が購入評価の前面に出してきたのに対し、当社の対応が遅れたこと。また、当社の新製品開発が第2四半期にずれ込んだこと等により上記の結果となった。
- 当社の課題は明白であったため、新製品の投入(後記)により今後の業績回復を図る。

2006年3月期第1四半期の業績

(2005年4月1日～2005年6月30日)

(単位:百万円)

	第1四半期	(参考)05/3月期
売上高	90	2,250
営業利益	98	529
経常利益	97	527
純利益	62	334

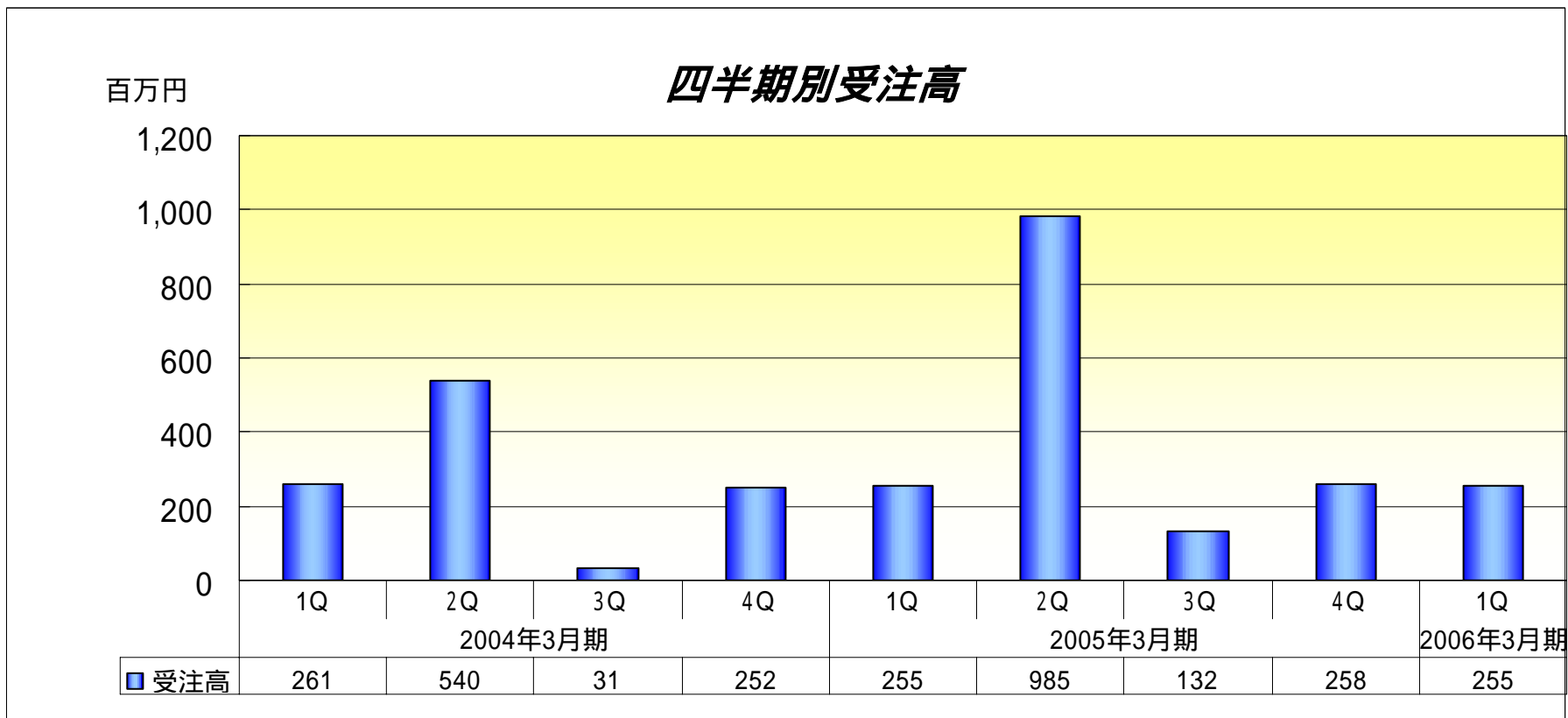
主な資産及び負債の変動について

(参考)

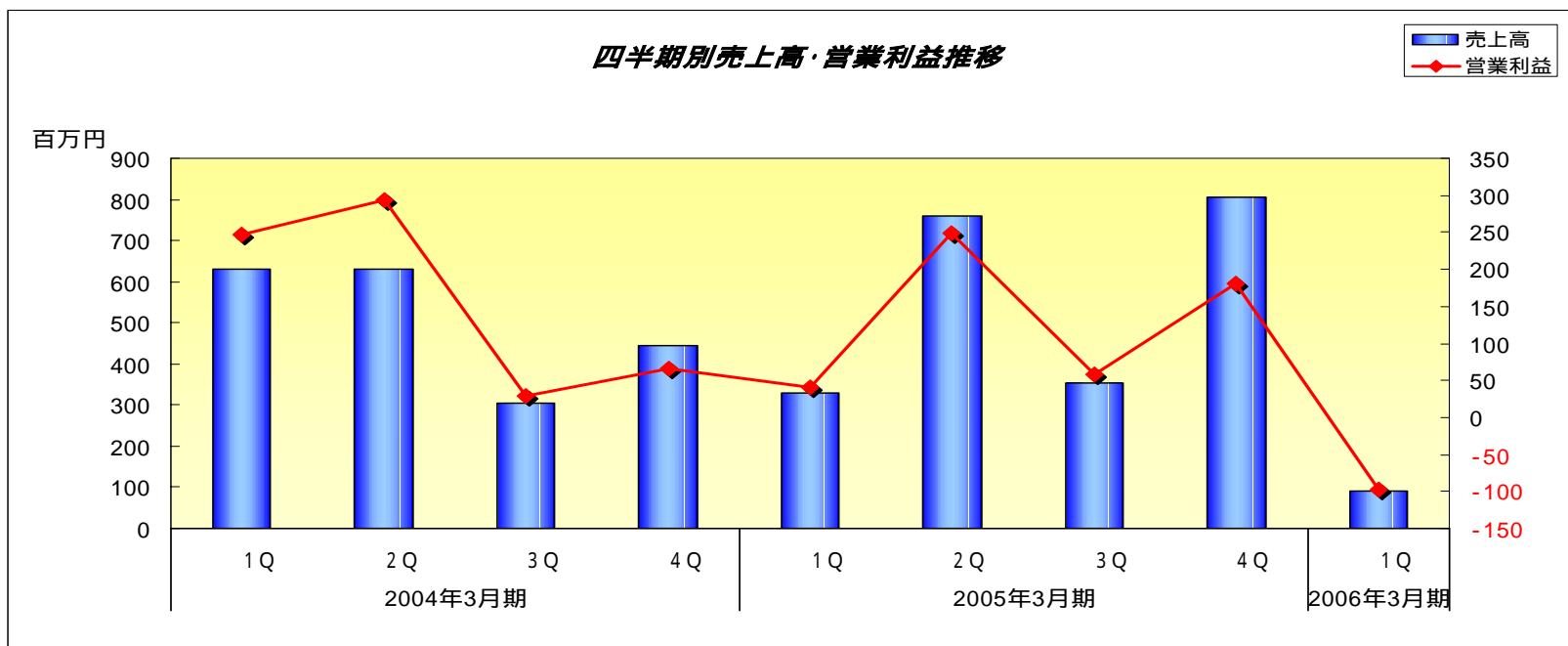
(単位:百万円)

(資産)	第1四半期	05/3月期	増減	内容
現預金・有価証券	1,323	1,394	71	
受取手形・売掛金	433	743	310	受手 253、売掛金 57
たな卸資産	449	340	109	製品 55、仕掛品153、原材料11
その他流動資産	81	69	12	
固定資産	376	374	2	
総資産	2,665	2,923	258	
(負債・資本)				内容
買掛金	244	239	5	
短期借入金	141	144	3	
その他流動負債	100	230	130	未払法人税等 88、前受金 22
長期借入金	68	80	12	
その他固定負債	156	152	4	
資本の部	1,952	2,072	120	第1四半期損失 62、社外流出 58

四半期別受注高推移



四半期別売上高・営業利益推移



(単位:百万円)

	2004年3月期				2005年3月期				2006年3月期
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
売上高	630	631	304	443	330	760	355	804	90
営業利益	247	293	29	66	41	248	59	180	-98

2.当期の業績見通し修正について

業績見通しの修正

(単位:百万円)

	第1Q	06/3期予想				05 / 3期
	実績	中間期		通期		通期実績
		今回	5/12時点	今回	5/12時点	
売上高	90	380	972	1,880	2,300	2,250
経常利益	97	175	100	203	450	527
(売上高比)	-	-	10.3%	10.8%	19.6%	23.4%
当期純利益	62	112	60	128	283	334
(売上高比)	-	-	6.2%	6.8%	12.3%	14.9%

業績修正の理由

- 顧客から製品の引き合いがあったものの、これまで当社装置は量産ラインでは仕上がりマスクとレジストマスクを混在させないのが普通であり、レジストマスクの測定は例外的であった。しかし、競合企業がレジストマスクの性能を購入評価の前面に出してきたのに対し、当社の対応が遅れたこと。当社の新製品開発が第2四半期にずれ込んだことにより、受注・売上計画が当初計画通りとならなかったこと。
- 今後は新製品EMU-270により巻き返しを図るものの、投入がずれ込んだため当初見込みの達成は厳しいと考えざるを得ず、中間期・通期ともに業績修正を行うもの。

今後の課題と対応

- 当面、性能・特長で競合他社を上回る、新製品EMU-270の投入により早期にシェアの回復を図る。
- 売上の減少に見合った原価低減、販管費削減を徹底する。
- 欠陥検査装置DIS-05の販売を早期に行い、業績の変動幅の縮小を図る。

3.新製品の販売について

EMU-270

DIS-05

新製品

45nm対応 マスクCD-SEM

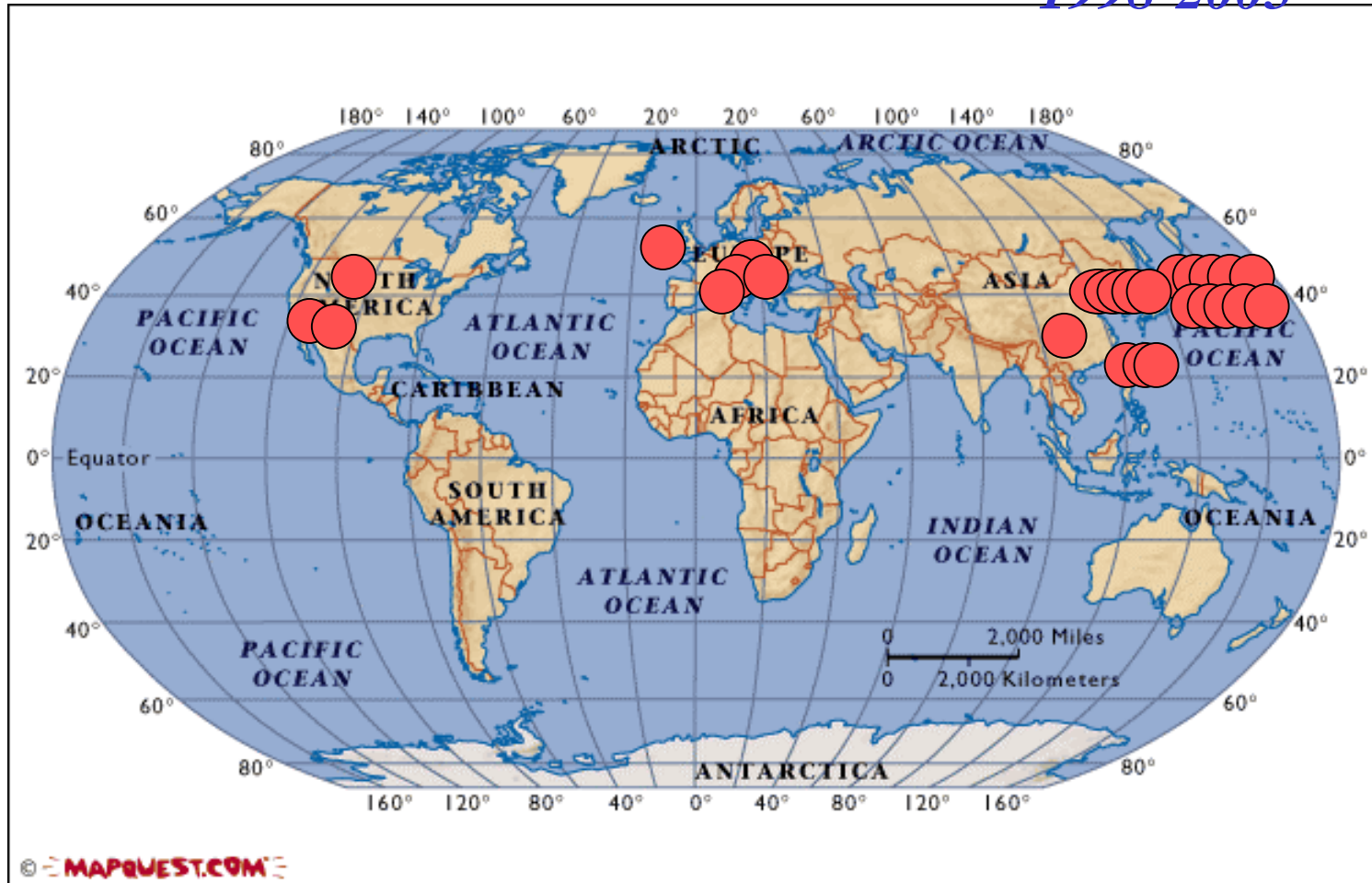
EMU-270

N. Anazawa

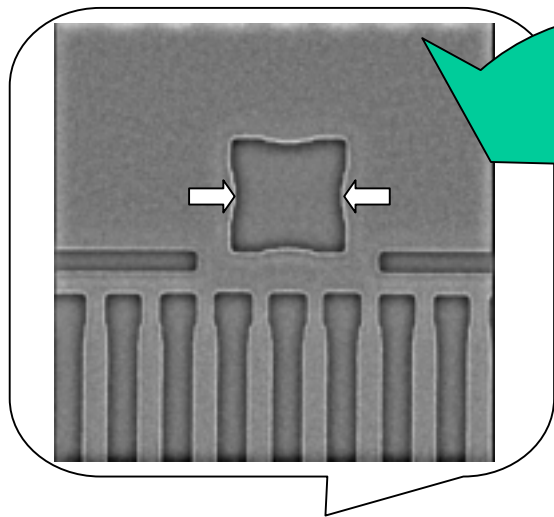
HOLON

HOLON Mask CD-SEM Market

1998-2005

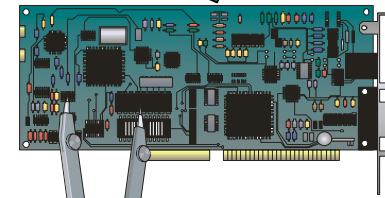
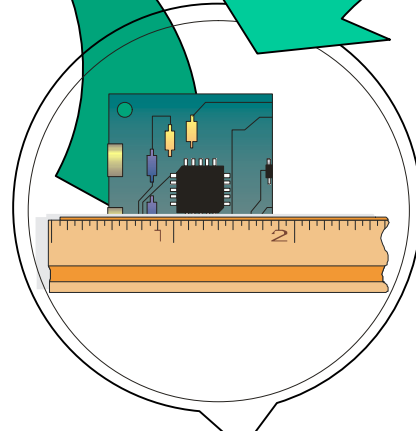


微小寸法測定とは



x300倍

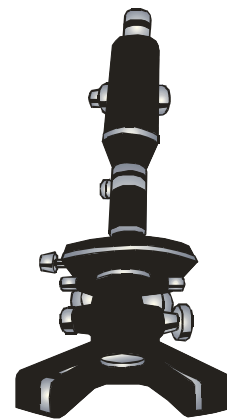
x300倍



コンパス



電子顕微鏡(CD-SEM)



光学顕微鏡

HOLON

45nmデザインルールに要求される測定再現性

測定装置の%トレランスは25%以下でなければならない

技術ノード	90nm	65nm	45nm	32nm
Tolerance	14nm	10nm	7nm	5nm
S0.4 L0.5	7.9	11.0	15.7	22.0
EMU -270 S0.4 L0.8	11.0	15.4	22.0	30.8
S0.5 L0.8	11.6	16.2	23.2	32.5
S0.5 L1.0	13.7	19.2	27.5	38.5
S0.5 L1.2	16.0	22.4	31.9	44.7
S0.5 L1.4	18.3	25.6	36.5	51.1
S0.8 L0.8	13.9	19.5	27.8	38.9
S0.8 L1.0	15.7	22.0	31.5	44.1
S0.8 L1.2	17.7	24.8	35.4	49.6
S0.8 L1.4	19.8	27.7	39.6	55.5
S1.0 L1.0	17.4	24.3	34.7	48.6
S1.0 L1.2	19.2	26.9	38.4	53.7

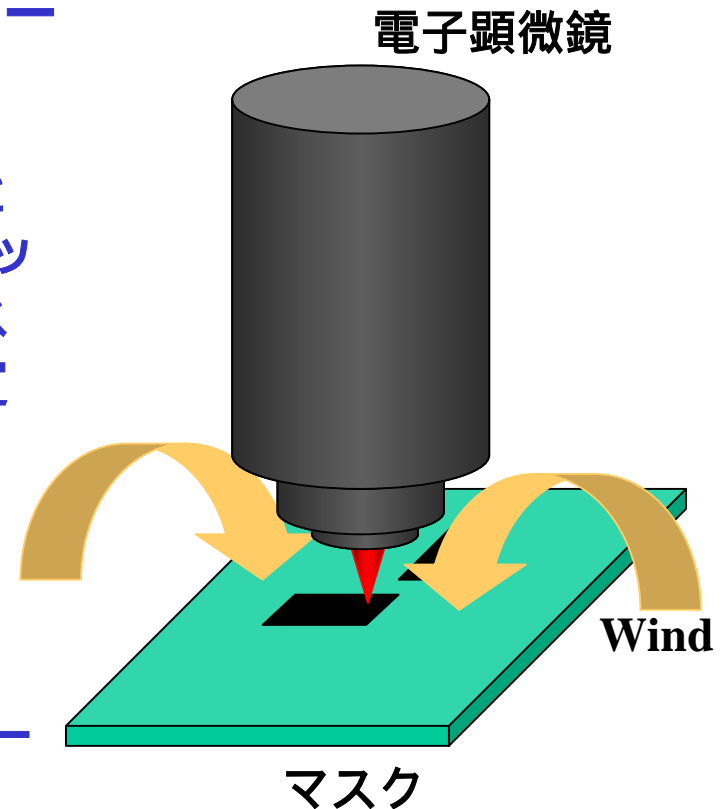
Short-term, Long-term 再現性 (3σ)

EMU-270の特長

全てのマスクに対応できるチャージ対策：“Wind-SEM”

より厳しくなるチャージアップ対策として新たに“Wind”方式を採用し、エッチング後のレジストマスクを含むすべてのマスクを安定して計測でき、測定再現性などの性能を向上させました。

Wind方式とはチャンバー内の圧力を高く保ち、チャンバー内に一定の風（Wind）をあたえることによりチャージを抑制するものです。



EMU-270 性能対比

		EMU-250	EMU-270
対応マスク		COG/PSM	COG/PSM/ Resist (ADI/AEI)
チャージ対策		Charge-Killer	Wind-SEM方式
再現性	Static* ¹	0.5nm	0.4nm
	Dynamic* ²	0.8nm (COG)	0.8nm (COG/PSM) 1.0nm (Resist)
位置きめ精度		± 400nm	± 150nm
スループット(MAM* ³)		10 sec/meas.	6 sec/meas.

*¹10 measurements (COG), *²Slope<0.05nm/meas. , *³ x/y meas./point

語句の説明

- レジストマスク

マスク上に回路パターンを作る過程で、マスク表面にレジスト（感光剤）を薄く均一に塗布します。次の露光工程で回路パターンの像をレジストに当てます。このマスクを現像液の中に浸して現像すると、光が当たった部分のレジストが溶けるタイプ（ポジレジスト）と、光が当たらない部分が溶けるタイプ（ネガレジスト）があります。いずれの場合でも現像後のレジストが残っているマスクをレジストマスクと呼んでいます。

語句の説明

- Static再現性

再現性を図る指標で、パターンを連続10回測定して得られたデータの3 σ （シグマ）。

- Dynamic再現性

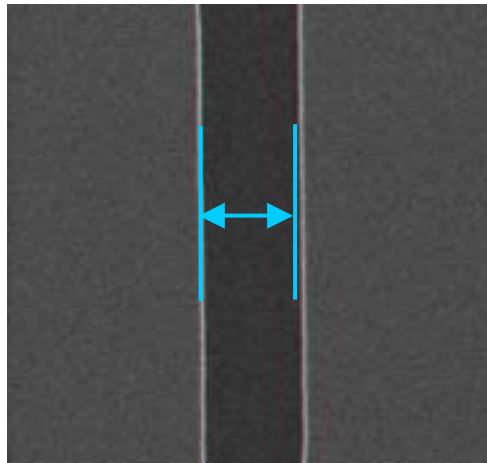
再現性を図る指標で、パターンを多数個、移動しながら測定し、この1ループの測定を10回繰り返す。各パターン毎に得られたデータ（10個）の3 σ （シグマ）。ループ毎にロード・アンロードする場合としない場合がある。

新開発
超解像欠陥検査装置

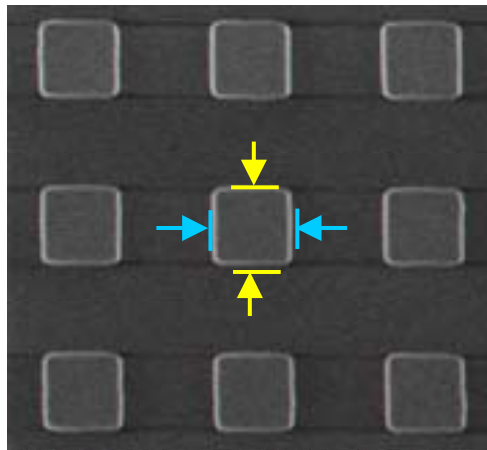
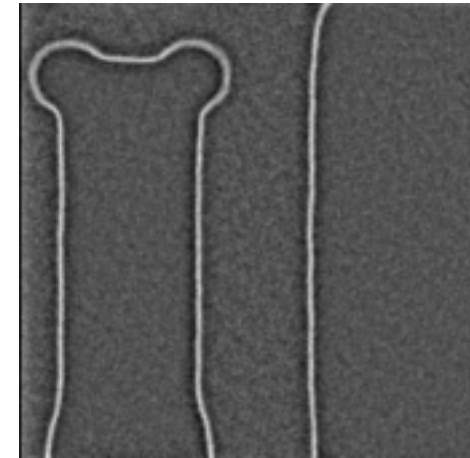
DIS-05

HOLON

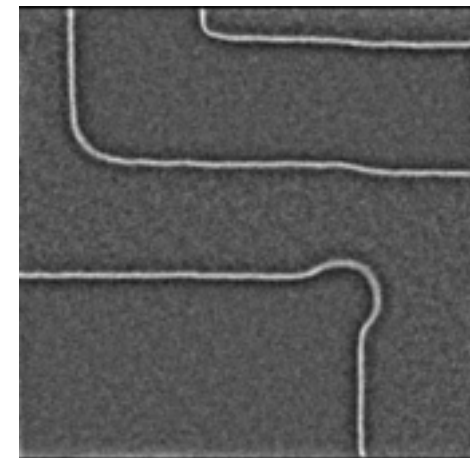
超解像パターンの計測と検査



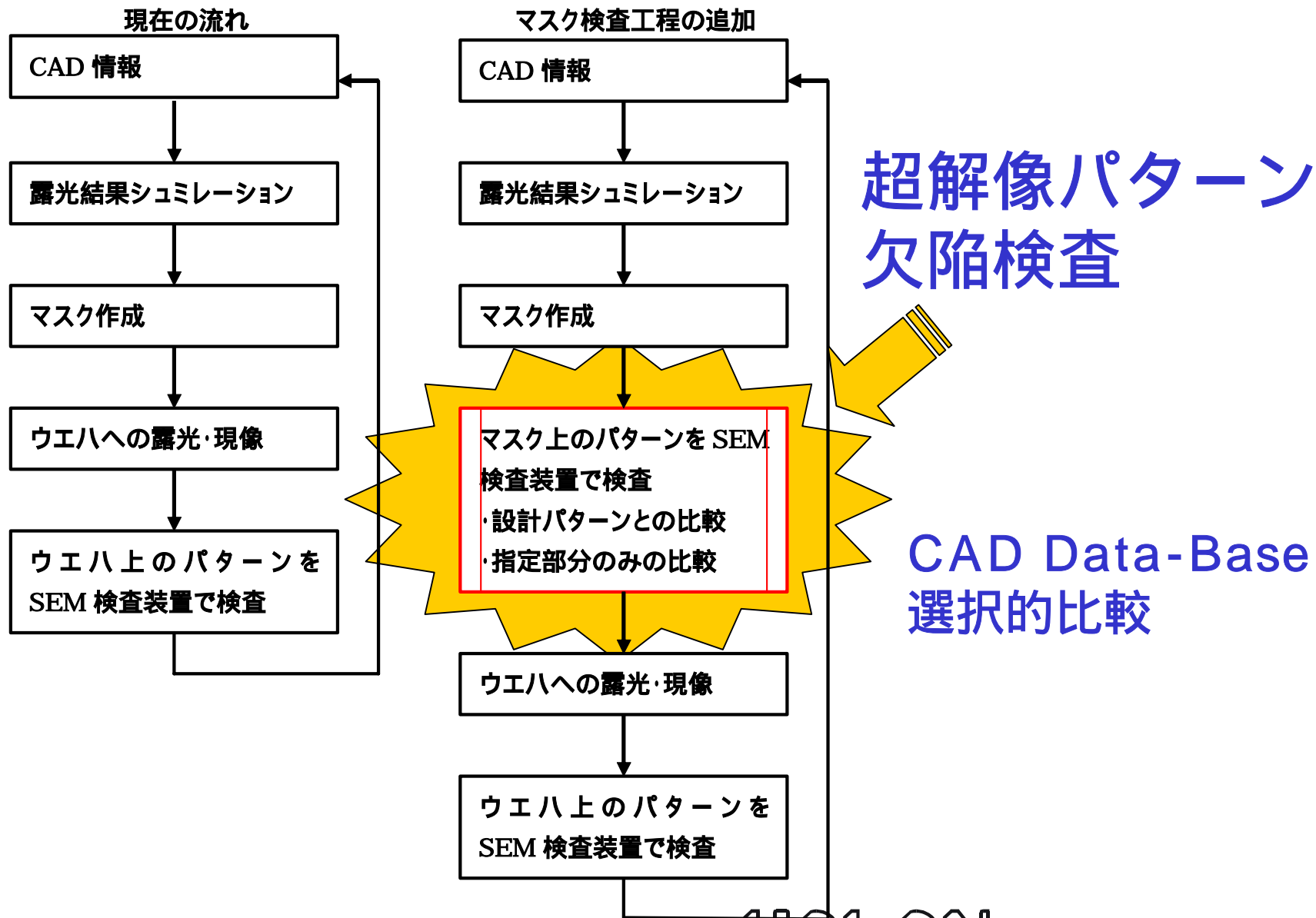
これまでの単純な
CD Markingでは
測定位置を正確に
指定できない対象



単純な「長さ」や
「幅」では測定で
きない対象

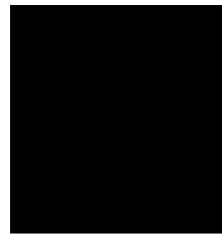


マスク工程の中の使用箇所



形状検査

- 1 . 設計 (C A D) パターンとマスクに描画されたパターンの形状差 (違い) の検出

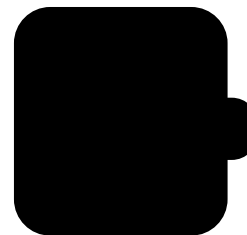
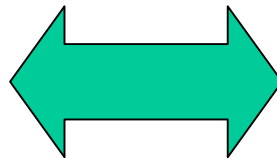
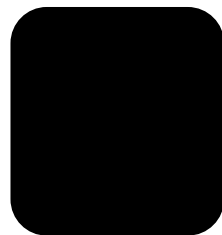


C A Dパターン



S E M画像パターン

- 2 . マスクに描画された同一パターンの比較
マスク面内の場所による形状、寸法の違いを検出



業績見通しの開示について

- 本資料に記載されている内容は、現時点で入手可能な情報に基づき予測したものであり、下記のリスク等や不確定要因等を含んだものであることをご了承願います。
- 当社の製品については国内販売については検収基準、海外については船積基準ですが、新製品等の一部については検収基準により売上を計上しております。本資料における売上見込みは現時点での進捗見込みに基づくものであり、検収が遅れるリスクを含んでおります。
- また、当社を取り巻く経済情勢、株式市場動向等により、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異なる結果となる可能性もあります。